

обсуждения, В.И. Малаховой и С.Д. Якубовичу за предоставление полупроводниковых излучателей.

Список литературы

- [1] Королев А.Е., Назаров В.Н., Стаселько Д.И. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. В. 12. С. 732-737.
- [2] Bölg er B. // JOSA. 1978. V. 68. N 11. P. 1622.
- [3] Акупшин А.М., Величанский В.Л., Вартанян Т.А. и др. // Опт. и спектр. 1989. Т. 66. В. 4. С. 723-725.
- [4] Малахова В.И., Ривлин Л.А., Тамбиров Ю.А. Якубович С.Д. // Квант. электрон. 1980. Т. 7. В. 6. С. 1252-1256.
- [5] Королев А.Е., Стаселько Д.И. // Опт. и спектр. 1984. Т. 57. В. 2. С. 299-305.
- [6] Акупшин А.М., Саутенков В.А., Вартанян Т.А. и др. // Кр. сообщ. по физике ФИ АН СССР. 1987. № 5. С. 42-44.
- [7] Bernabeu E., Alvarez J.M. // Phys. Rev. A. 1980. V. 22. N 6. P. 2690-2695.
- [8] Королев А.Е., Назаров В.Н. // Тез. докл. Учен. конф. по голограммии. Рига, 1985. С. 132-133.
- [9] Steel D.G., Lind R.C., Lam J.F., Giuliano C.R. // Appl. Phys. Lett. 1979. V. 35. N. 5. P. 376-379.
- [10] Zajonc A.G., Phelps A.V. // Phys. Rev. A. 1981. V 23. N 5. P. 2479-2487.
- [11] Allegri M., Gabbanini C., Moi L. // J. de Phys. 1985. V. C1. V. 46. P. C1-61-C1-73.

Поступило в Редакцию
28 июля 1989 г.

Письма в ЖТФ, том 15, вып. 20

26 октября 1989 г.

11

ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ЖИДКОМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК ИОНОВ ОЛОВА

В.В. Кавицкий, В.Б. Казначеев,
А.Б. Мокров

Перспективы субмикронной ионно-пучковой литографии в значительной степени определяются достижениями в области жидкотемпературных источников ионов (ЖМИИ). Большинство опубликованных

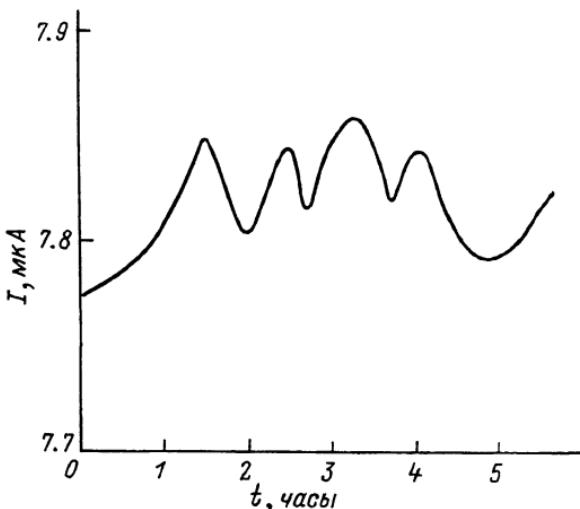


Рис. 1. Изменение тока эмиссии ЖМИИ олова по времени.

исследований ЖМИИ посвящено в основном двум вопросам – расширению спектра эмиттируемых ионов и построению модели, описывающей их работу. Основными параметрами источника с точки зрения его использования в литографической установке являются: стабильность тока эмиссии, стабильность положения виртуальной эмиттирующей области, а также срок службы [1]. На пути улучшения этих параметров имеются известные трудности.

Основой ЖМИИ является иглообразное остриё с радиусом вершины порядка нескольких микрон, смоченное расплавленным рабочим веществом. Качество источника определяется в основном тем, насколько хорошо соответствуют друг другу рабочее вещество и материал острия. Если при этом взаимодействие между ними мало – ухудшается смачиваемость, если велико – происходит растворение острия в расплаве. По этой причине описанные в литературе источники ионов олова, использующие, как правило, острия из железа или никеля, имеют малый срок службы [2].

В разработанном нами источнике используется острие из более стойкого материала – вольфрама. Поскольку смочить его оловом не удается, на поверхности острия был создан подслой титана. Исследование полученных таким образом источников ионов олова обнаружило высокую стабильность тока эмиссии (рис. 1). Так, при ионном токе порядка 10 мА наблюдались лишь медленные (с постоянной времени порядка 0.5–1 часа) колебания тока с амплитудой до 1% от величины тока. Ресурс экспериментального ЖМИИ, определяющийся запасом олова, составлял 50–100 часов. После повторных заправок оловом работоспособность и рабочие характеристики источников восстанавливались.

Масс-спектр разработанного нами источника ионов олова представлен на рис. 2. Ионы титана в спектре зарегистрированы не были.

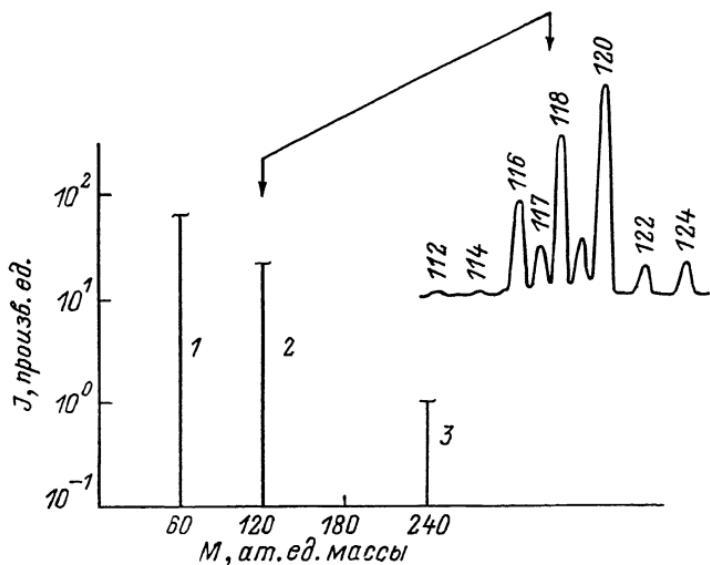


Рис. 2. Масс-спектр ЖМИИ олова ($1 = 10 \text{ мкА}$). 1 - Sn^{+2} ,
2 - Sn^+ , 3 - Sn_2^+ .

В процессе работы источника ионов титановый подслой не разрушался.

С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] Hiroshi Arimoto et al. // Japanese Journ. of Appl. Phys. 1986. V. 25. N 6. P. 1507-1509.
- [2] Наумовец А.Г. и др. Отчет по теме „Разработка жидкокометаллических источников ионов”. Киев, ИФ АН УССР, 1986. 61 с.

Поступило в Редакцию
3 сентября 1989 г.